

Nakajima et al Filed 8/30/01 #5 Q4096 Hollie 10f2

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 8月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-264083

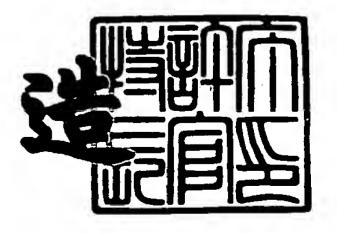
出 願 人 Applicant (s):

日本電気株式会社

jc857 U.S. PTO 09/941744 08/30/01

2001年 2月23日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 及川耕



【書類名】

特許願

【整理番号】

72310227

【提出日】

平成12年 8月31日

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

H01L 21/60

【発明の名称】

半導体装置

【請求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝5丁目7番1号

日本電気株式会社内

【氏名】

中嶌 嘉啓

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095740

【弁理士】

【氏名又は名称】

開口 宗昭

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

025782

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9606620

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極を有する半導体チップと、リード端子を有する配線材と、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

粗面化された前記金属板の表面が前記封止樹脂と接合されてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 電極を有する半導体チップと、リード端子を有する配線材と、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

ディンプル加工された前記金属板の表面が前記封止樹脂と接合されてなることを 特徴とする半導体装置。

【請求項3】 前記金属板と前記電極及び前記リード端子とは前記金属板に施された部分メッキを介して接合し、前記封止樹脂は前記金属板の素材に接合することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の半導体装置。

【請求項4】 電極を有する半導体チップと、リード端子を有するリードフレームと、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

前記リード端子は下がった段部を有し、前記リード端子と前記金属板とが前記 段部に塗布された導電性接合材を介して接合されてなることを特徴とする半導体 装置。

【請求項5】 電極を有する半導体チップと、リード端子を有するリードフレームと、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

前記金属板に設けられた爪部が前記リードフレームに嵌合されてなることを特 徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、樹脂モールドされてなる半導体装置、すなわち、プラスチックパッケージに関し、特に、半導体チップの電極とリード端子との間を、銅などからなる 金属板によって電気的に接続したプラスチックパッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】

樹脂モールドされてなる半導体装置、すなわち、プラスチックパッケージは、 半導体チップ(ペレット又はダイともいう。)と、外部端子を形成するリードフ レーム等の配線材と、前記配線材にボンディングされた前記半導体チップ及びイ ンナーリードを封止する封止樹脂とを備えてなる。

配線材としては、リードフレームのほかテープキャリア(フィルムキャリア) や、プリント配線板等が用いられている。封止樹脂としてはエポキシ樹脂が主流 となっている。

[0003]

半導体チップの電極と配線材のリード端子との間を電気的に接続する方法として、従来よりワイヤボンディング法が多用されている。図8は、ワイヤボンディング法による従来の一例の半導体装置1を示す図である。図8(a)は平面図、図8(b)は図8(a)におけるA-A線断面図である。

図8に示すようにこの半導体装置1は、MOSFETを構成する半導体チップ10をリードフレーム20に搭載、接合し、ボンディングワイヤ7によって電気的接続をとり、モールド樹脂8によって封止した8ピンSOPである。半導体チップ10は上面にゲート電極11及び3つのソース電極12を有し、底面にドレイン電極(図示せず)を有する。リードフレーム20は、パッケージの相対する2つの側部に突設されるリードを備えており、図上左側部には、4本のドレインリード21、図上右側部には1本のゲートリード22及び3本のソースリード2

3を備える。ドレインリード21はパッケージ内部において一体形成されており、それによりアイランド部24が構成される。ゲートリード22はパッケージ内部においてインナーリード端子部(以下、ゲート端子という。)25を有する。3つのソースリード23のそれぞれはパッケージ内部においてインナーリード端子部(以下、ソース端子という。)26を有する。半導体チップ10はアイランド部24に電気的に接続される。半導体チップ10の上面上のゲート電極11とリードフレーム20のゲート端子25とはボンディングワイヤ7により接続される。また、ソース電極12とリードフレーム20のソース端子26とはボンディングワイヤ7により接続される。半導体チップ10、インナーリード(アイランド部24、ゲート端子25、ソース端子26を含む。)及びボンディングワイヤ7は、モールド樹脂8によって封止され、パッケージングされる。

[0004]

以上の半導体装置1は、大電流用途のパワートランジスタの例であり、低抵抗化を図るためソース電極12とゲート端子25との間をできるだけ多くの金線等のボンディングワイヤ7により接続している。

しかし、金線等の高価な細い金属線によるワイヤボンディング法では、製造コストが大幅にアップするばかりか、細い金属線に断線が発生することで、大電流用には適しない等の問題があり、近時、大電流用途のパワートランジスタ等においては、銅などからなる金属板によって接続する方法が提案されている(特開平8-148623)。金属線に比較して、金属板は、断面積を大きくとれるため、抵抗の低減、放熱性の向上等の利点が認められる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、金属板によって半導体チップの電極と配線材のリード端子との間を電 気的に接続するプラスチックパッケージにおいては、以下のような問題があった

[0006]

まず、金属板によって半導体チップの電極と配線材のリード端子との間を電気

的に接続するプラスチックパッケージの適用例につき説明する。図9は、金属板接続による半導体装置2を示す図である。図9(a)は平面図、図9(b)は図9(a)におけるB-B線断面図である。

図9に示すようにこの半導体装置2は、MOSFETを構成する半導体チップ 30をリードフレーム40に搭載、接合し、ボンディングワイヤ7及び銅板等の 金属板50によって電気的接続をとり、モールド樹脂8によって封止した8ピン SOPである。半導体チップ30は上面にゲート電極31及び単一の大面積のソ ース電極32を有し、底面にドレイン電極(図示せず)を有する。リードフレー ム40は、パッケージの相対する2つの側部に突設されるリードを備えており、 図上左側部には、4本のドレインリード41、図上右側部には1本のゲートリー ド42及び3本のソースリード43を備える。ドレインリード41はパッケージ 内部において一体形成されており、それによりアイランド部44が構成される。 ゲートリード42はパッケージ内部においてゲート端子45を有する。3つのソ ースリード43はパッケージ内部において一体形成され単一の幅広のソース端子 46を有する。半導体チップ30はアイランド部44にダイボンド材9を介して 接着され、そのドレイン電極(図示せず)がアイランド部44に電気的に接続さ れる。半導体チップ30の上面上のゲート電極31とリードフレーム40のゲー ト端子45とはボンディングワイヤ7により接続される。ソース電極32とリー ドフレーム40のソース端子46とは銅からなる金属板50により接続される。 金属板50は、導電ペースト6を介してその一端がソース電極32に、他端がソ ース端子46に接合され、ソース電極32とソース端子46とを電気的に接続す る。半導体チップ30、インナーリード(アイランド部44、ゲート端子45、 ソース端子46を含む。)、ボンディングワイヤ7及び金属板50は、モールド 樹脂8によって封止され、パッケージングされる。

図9に示すように金属板50は、パッケージの外形寸法の半分程度の幅に形成され、金線に比較して極度に断面積が大きくとられている。これによりパッケージの低抵抗化が図られる。

[0007]

半導体装置はパッケージングされた後、実装時、使用時において温度・湿度・

圧力等の変化を伴う厳しい環境下におかれる。半導体装置が温度変化を繰り返し受けることにより、金属板と封止樹脂との熱膨張係数差に起因する熱応力により、金属板と封止樹脂との接合が破壊され、金属板が樹脂から剥離した状態になる場合がある。その剥離した界面を通じて、水分や、腐食性ガスが侵入し、半導体チップを腐食するという不具合が発生する。その結果、半導体装置の信頼性を低下させる。

金属線を用いた場合には、そのような封止樹脂との剥離が生じても金線の断面 積が小さいため、水分やガスの侵入経路が比較的狭く、半導体装置の信頼性を害 するほど金属線と封止樹脂との界面を通じて水分やガスが侵入することは少ない

しかし、金属板は金属線に比較して断面積が大きく、また、低抵抗化や放熱性 向上の要請により意図的に断面積を大きくされ、封止樹脂との接触面積が自ずと 大きくなるため、水分やガスの侵入経路が幅広になり、水分やガスの侵入によっ て半導体装置の信頼性が害されるという問題が生じ易い。

[0008]

また、リード端子と金属板との接合に半田ペーストや樹脂系導電ペーストが用いられるが、金属板とリード端子との接合範囲以外に半田ペーストや導電ペーストが流れてしまうことがある。半田ペーストや導電ペーストがリード端子からリード延設方向にリード上を流動し、リード端子からパッケージ外周位置や外周付近までに亘り広がった場合等には、導電ペースト等が封止樹脂の接着性を低下させ、封止樹脂の剥離を発生させる。そのため、外部からの水分、ガス等の侵入を容易にしてしまい、半導体チップを腐食する結果、半導体装置の信頼性を低下させるという問題がある。

[0009]

一方、金属板を精度良く半導体チップの電極及びリード端子上に搭載することが望まれる。

[0010]

本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、半導体 チップの電極とリード端子との間を、銅などからなる金属板によって電気的に接 続し、樹脂封止されてなる半導体装置(プラスチックパッケージ)に関し、金属板と封止樹脂との密着性を向上することにより、封止樹脂による密閉性(封止性)を向上し、半導体装置の信頼性の向上を図ることを課題とする。

また、リード端子と金属板との接合に用いられる導電性接合材が、金属板とリード端子との接合範囲以外に、特にリード上をパッケージ外方に流れ広がることを防止することにより、リードと封止樹脂との密着性、封止樹脂による密閉性(封止性)を向上し、半導体装置の信頼性の向上を図ることを課題とする。

さらに、金属板を精度良く半導体チップの電極及びリードフレームのリード端子上に精度良く容易に搭載することができる半導体装置を提供することを課題とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決する発明は、電極を有する半導体チップと、リード端子を有する配線材と、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

粗面化された前記金属板の表面が前記封止樹脂と接合されてなることを特徴とする半導体装置である。

[0012]

したがって本発明の半導体装置によれば、粗面化された前記金属板の表面が前記 記封止樹脂と接合されてなるので、金属板と封止樹脂との密着性が向上する。

ここで、粗面化には微視的に粗くすること(微視的に凸凹な面を形成すること)及び巨視的に粗くすること(巨視的に凸凹な面を形成すること)の双方が含まれる。微視的に粗くすることのみならず、巨視的に粗くすることも封止樹脂との密着性を向上させるために有効だからである。

したがって、金属板表面にいくつかの窪みを形成するディンプル加工により粗 面化された金属板の表面が前記封止樹脂と接合する構造を採っても良い。

金属板の表面の粗面化は、金属板の素材の一部を除去する方法、金属板に異物を付着させる方法、金属板を塑性変形させる方法等により行うことができる。具

体的には、エッチング、化学研磨、針状メッキ等の粒子を金属板表面に付着させる方法、サンドブラスト法、金型の凹凸を転写する方法等により行うことができる。

[0013]

また、前記金属板にメッキを施す場合には、金属板の全面をメッキせずに、半導体チップの電極との接合面及びリード端子との接合面に部分メッキを施すことが有効である。金属板の封止樹脂との接合面にメッキを施すと金属板表面が平滑化し、樹脂との密着性が低下するからである。すなわち、前記金属板と前記電極及び前記リード端子とは前記金属板に施された部分メッキを介して接合し、前記封止樹脂は前記金属板の素材に接合する。半導体チップの電極との接合面及びリード端子との接合面はメッキにより導電性が向上し、例えば、酸化被膜の発生が防止されるので、金属板と電極との間の接触抵抗の増大が防止される。一方、封止樹脂は金属板の素材に接合し密着性が維持できる。

[0014]

またリード端子と金属板との接合に用いられる導電性接合材が、金属板とリード端子との接合範囲以外に、特にリード上をパッケージ外方に流れ広がることを 防止するためには、次の発明が解決手段となり得る。

すなわち、電極を有する半導体チップと、リード端子を有するリードフレームと、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

前記リード端子は下がった段部を有し、前記リード端子と前記金属板とが前記 段部に塗布された導電性接合材を介して接合されてなることを特徴とする半導体 装置である。

リード端子に下がった段部があることにより、リード端子を基点としてリード の延設方向に辿ってリード観察した場合に立ち上がった壁面が形成される。この 壁面により導電性接合材のリード上での流動が抑止され、導電性接合材がリード 上をパッケージ外方に流れ広がることが防止される。段部は、下がった段部とする。上がった段部とすると、リード端子を基点としてリードの延設方向に辿って

観察した場合に立ち下がった壁面が形成されるのみであり、かかる立ち下がった 壁面により導電性接合材のリード上での流動を抑止することができないからであ る。ここで、導電性接合材としては半田ペーストやの導電ペーストが該当する。

[0015]

また、金属板を精度良く半導体チップ及びリード端子上に搭載するには次の発明が解決手段となりうる。

すなわち、電極を有する半導体チップと、リード端子を有するリードフレームと、前記電極と前記リード端子との間を電気的に接続する金属板と、前記半導体チップ、前記配線材の一部及び前記金属板を封止する封止樹脂とを備える半導体装置において、

前記金属板に設けられた爪部が前記リードフレームに嵌合されてなることを特 徴とする半導体装置である。

金属板搭載時に金属板の爪部をリードフレームに嵌合させることにより、半導体チップ及びリード端子上の所定の位置に精度良く金属板を配置することができる。前記爪部を2以上設けることが好ましい。1つでは1点で係止することとなるので、金属板が爪部を支点として回転したり、位置がずれたりするおそれがあるからである。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の一実施の形態の半導体装置につき図面を参照して説明する。以下 は本発明の一実施形態であって本発明を限定するものではない。

[0017]

実施の形態1

まず、本発明の実施の形態1の半導体装置3につき、図1を参照して説明する。図1は本発明の実施の形態1の半導体装置3を示す図であり、図1(a)は平面図、図1(b)は図1(a)におけるC-C線断面図である。

[0018]

図1に示すようにこの半導体装置3は、MOSFETを構成する半導体チップ3 0をリードフレーム60に搭載、接合し、金線等のボンディングワイヤ7及び金

属板としての銅板51によって電気的接続をとり、エポキシ樹脂等からなるモー ルド樹脂8によって封止した8ピンSOPである。半導体チップ30は上面にゲ ート電極31及び単一の大面積のソース電極32を有し、底面にドレイン電極(図示せず)を有する。これらの電極は例えば、アルミニウム若しくはアルミニウ ム合金電極、金電極又は金メッキ、銀メッキ等のメッキ電極である。リードフレ ーム60は、パッケージの相対する2つの側部に突設されるリードを備えており 、図上左側部には、4本のドレインリード61、図上右側部には1本のゲートリ ード62及び3本のソースリード63を備える。ドレインリード61はパッケー ジ内部において一体形成されており、それによりアイランド部64が構成される 。ゲートリード62はパッケージ内部においてゲート端子65を有する。3つの ソースリード63はパッケージ内部において一体形成され単一の幅広のソース端 子66を有する。半導体チップ30はアイランド部64にダイボンド材9を介し て接着され、そのドレイン電極(図示せず)がアイランド部64に電気的に接続 される。半導体チップ30の上面上のゲート電極31とリードフレーム40のゲ ート端子65とはボンディングワイヤ7により接続される。ソース電極32とリ ードフレーム60のソース端子66とは銅板51により接続される。銅板51の 一端は導電ペースト6を介してソース電極32に、他端は導電ペースト6を介し てソース端子66に接合され、銅板51によってソース電極32とソース端子6 6とを電気的に接続する。半導体チップ30、インナーリード(アイランド部6 4、ゲート端子65、ソース端子66を含む。)、ボンディングワイヤ7及び銅 板51は、モールド樹脂8によって封止され、パッケージングされる。モールド 樹脂8から露出したリード部分(アウターリード)は外部端子を構成する。

導電ペーストは、エポキシ樹脂やアクリル樹脂等の樹脂を主剤とし、硬化剤及び銀粉等の導電性材料を充填した接着剤である。導電ペーストに代えて半田ペーストを用いても良いが、熱膨張係数差に起因した熱応力を緩和するためには低弾性の導電ペーストを用いることが望ましい。

[0019]

銅板51は、Cu合金からなるものである。銅板に代えてFe-Ni42合金 等の材料からなる金属板を用いてもよいが、放熱性を求める場合にはCu合金か らなる銅板を選択する。

銅板51は、図1(a)に示すようにパッケージ外寸の半分程度の幅を有する帯状の薄板であって、図1(b)に示すように、ソース電極32との接合面及びソース端子66との接合面が平坦に形成され、それらの接合面を繋ぐ中間部分が折り曲げ形成されている。この銅板51はプレス加工によって形成することができる。

銅板51の上面(ソース電極やソース端子と接合する面の反対面)は、粗面化されており、底面には部分銀メッキ52が施されている。これを図2、図3及び図4を参照して説明する。図2は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その1)を示す図である。図2(a)は上面図、図2(b)は図2(a)におけるD-D線断面図、図2(c)は底面図である。

図2に示すように、銅板51はその上面にディンプル53を有する。このディンプル53は、銅板51に設けられた窪みであって、エッチングや、プレス加工によって形成することができる。エッチングにより形成する場合には、エッチングを完全に行わないハーフエッチングにより形成する。エッチングを完全に行う場合には、除去される銅が多くなり、銅板51の抵抗値が上がる。銅板51の抵抗値が問題とならない場合には、エッチングを完全に行い、ディンプル53に代えてスルーホールを形成しても良い。スルーホールによってもモールド樹脂8との密着性が向上するからである。

[0020]

また、銅板51の底面には、銀メッキ52が施される。銀メッキ52は銅板5 1の腐食を防ぎ導電性を維持し、ソース電極32及びソース端子66との接触抵抗を下げるためのものである。図2に示すように銀メッキ52は、銅板51の底面の全面には施されず、ソース電極32及びソース端子66との接合面に施される。一方、銅板51の上面には銀メッキは施されない。

[0021]

以上の構造を有する銅板51が図1に示すような態様で樹脂封止されることにより、モールド樹脂8の一部がディンプル53に充填されて硬化するため、銅板51とモールド樹脂8との密着性が向上し、半導体装置3の信頼性が向上する。

[0022]

また、銅板51の粗面化された構造としては、図3又は図4に示すような構造を採っても良い。図3は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その2)を示す図である。図3(a)は上面図、図3(b)は図3(a)におけるE-E線断面図、図3(c)は底面図である。

図3に示すように、銅板51の上面をサンドブラス法や化学研磨等により粗し加工する。すなわち、銅板51はその上面に粗し加工面54を有している。かかる構造を有する銅板51が図1に示すような態様で樹脂封止されることにより、モールド樹脂8が銅板51の素材に接合し、その一部が粗し加工面53の微少な凹部に充填されて硬化するため、銅板51とモールド樹脂8との密着性が向上し、半導体装置3の信頼性が向上する。

[0023]

図4は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その3)を示す図である。図4(a)は上面図、図4(b)は図4(a)におけるF-F線断面図、図4(c)は底面図である。

図4に示すように、銅板51の上面に針状メッキ55が付着し、定着させる。 かかる構造を有する銅板51が図1に示すような態様で樹脂封止されることにより、モールド樹脂8が銅板51の素材に接合し、微少な針状メッキ55の周囲に も充填されて硬化するため、銅板51とモールド樹脂8との密着性が向上し、半 導体装置3の信頼性が向上する。

[0024]

また、以上のディンプル53、粗し加工面54、針状メッキ55を設けるか否かに拘わらす、モールド樹脂8が銅板51の素材に接合するため、銅板51表面の酸素基がモールド樹脂8との密着性を向上させ、半導体装置3の信頼性が向上する。

[0025]

一方、図1に示すようにリードフレーム60には段部67及び溝部68が設けられている。これを図5を参照して説明する。図5は本発明の実施の形態1の半 導体装置3に用いられるリードフレーム60のソースリード63部分を示す部分 図である。図5(a)は平面図、図5(b) は側面図である。

[0026]

図5に示すように、ソース端子66に段部67が設けられている。ソース端子66は3本のソースリードが一体化されて幅広に形成されている。すなわち、パッケージ外形81と同一方向に長尺に形成されている。図5に示すように、段部67は周囲のリード上端より下がった段部である。ソース端子66を基点としてリードの延設方向に辿ってソースリードを観察した場合に立ち上がった壁面67aが形成される。壁面67aはパッケージ外形81とは平行に、ソースリード63の延設方向とは垂直に形成されている。

また、3本のソースリード63の各々に溝部68が設けられている。図5(a)に示すように、溝部68はパッケージ外形81とは平行に、ソースリード63の延設方向とは垂直に形成されたV字状の溝である。

[0027]

従来のリードフレームは、以上のような段部や溝部がなかっため、ソース端子上に半田ペースト又は導電ペーストを印刷又は塗布し、その上に金属板を搭載し、リフロー又はキュアするという一連の工程の中で、半田ペースト又は導電ペーストがソースリード上をパッケージ外方に向けて流れ、パッケージ外形81付近まで、又はパッケージ外形81を超えて広がってしまうことがあった。そのため、ソースリードとモールド樹脂との密着性を損ね、半導体装置の信頼性を低下させていた。

しかし、本実施形態の半導体装置3によれば、リードフレーム60に段部67 及び溝部68が設けられているので、段部67の底面に印刷又は塗布された半田ペースト又は導電ペーストがソースリード上を流れ出し広がることを段部67の壁面67aによって阻止することができる。また、万が一、壁面67aを超えて半田ペースト又は導電ペーストが流出しても、その流れは溝部68によって堰き止められる。その結果、ソースリード63とモールド樹脂8との密着性は損なわれることなく、半導体装置の信頼性が向上する。

[0028]

これらの段部67及び溝部68はリードフレームのプレス加工時に形成するこ

1 2

とができる。段部67はプレス加工時にソース端子66の一部が潰されて形成された段部であるが、潰さずに折り曲げて段部を形成しても良い。

また、段部67に代えて段部67と同位置に断面略U字状の溝部を形成しても良い。しかし、溝部とする場合、溝部からの半田ペースト又は導電ペーストが溢れだした場合に、ソースリード63上をパッケージ外方に向けて流れ出すおそれがあるので、上述のような段部とした方が有利である。段部とする場合は、パッケージ内方側には半田ペースト又は導電ペーストの流動を阻止する壁面はないので、余分な半田ペースト又は導電ペーストはパッケージ内方側に流動するからである。

[0029]

また、溝部68内にモールド樹脂8の一部が充填されて硬化するので、リードに設けられた溝部68によりリードフレーム60とモールド樹脂8との密着性が向上する。そのため、図1に示すようにドレインリード61及びゲートリード62にもパッケージ端面付近内部に溝部68を形成する。

[0030]

実施の形態 2

次ぎに本発明の実施の形態2の半導体装置4につき図6及び図7を参照して説明する。図6は本発明の実施の形態2の半導体装置4を示す図であり、図6(a)は平面図、図6(b)は図6(a)におけるG-G線断面図である。図7は本発明の実施の形態2の半導体装置4に用いられる銅板56を示す図である。図7(a)は上面図、図7(b)は図7(a)におけるH-H線断面図、図7(c)は底面図である。

[0031]

実施の形態2の半導体装置4は、実施の形態1の半導体装置3と同様の構成を 有する。しかし、銅板56に爪部58が設けられている点で異なる。

銅板56は実施の形態1における銅板51と同様に、銀メッキ57a、57b が施される。図7に示すように銀メッキ57a、57bは、銅板56の底面の全面には施されず、銀メッキ57aはソース電極32との接合面に、銀メッキ57b ソース端子66との接合面に施される。一方、銅板56の上面には銀メッキは

施されない。

銅板56は実施の形態1における銅板51と同様の形状を有するが、銅板56のソースリード63側の端部には3つの爪部58が延設されている。この3つの爪部58は図7(b)に示すように、銅板56の底面方向に折り曲げ形成されて、銀メッキ57bが施された面より下方に突出している。図6(a)及び図7(a)において上から2番目と3番目の爪部58は、3本のソースリード63の間隔にそれぞれ嵌合する。図6(a)及び図7(a)において上から1番目の爪部58は、ゲートリード62とソースリード63との間隔に挿入されるが、ゲートリード62には接触せず、ゲートリード62とは隔絶し、他の爪部58とともにソースリード63に嵌合する。

これらの爪部58は銅板56のプレス加工時に形成することができる。

[0032]

以上の爪部58を設けたことにより、銅板56の搭載時に爪部58をリード間に挿入しソースリード63に嵌合させることにより、銅板56を半導体チップ30のソース電極32及びソース端子66上に精度良く配置することができる。

[0033]

【実施例】

以下に、銅板の表面平均粗さRaの実施例を開示する。

未粗し加工の銅板の表面は O. 1 μmRaであった。

化学研磨(薬液処理)により粗面化された銅板の表面は $0.2\sim0.3\,\mu$ m R a であった。サンドブラストにより粗面化された銅板の表面 $0.3\sim0.4\,\mu$ m R a であった。針状メッキにより粗面化された銅板の表面 $0.3\sim0.4\,\mu$ m R a であった。

[0034]

【発明の効果】

上述のように本発明は、粗面化した金属板の表面に封止樹脂を接着したので、 金属板と封止樹脂との密着性が向上することができるという効果があり、また、 導電性接合材が塗布されるリード端子部分に下がった段部を設けたので、接合材 の流出を防止することができるという効果があり、その結果、封止樹脂の密着性 、封止樹脂による密閉性(封止性)が向上し水分やガス等の侵入を防ぎ、半導体 装置の信頼性が向上するという効果がある。

また、金属板に設けられた爪部をリードフレームに嵌合させる構造により、金属板を容易に精度良く半導体チップの電極及びリードフレームのリード端子上に搭載することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

ŕ

- 【図1】 図1は本発明の実施の形態1の半導体装置3を示す図であり、図1(a)は平面図、図1(b)は図1(a)におけるC-C線断面図である。
- 【図2】 図2は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その1)を示す図である。図2(a)は上面図、図2(b)は図2(a)におけるD-D線断面図、図2(c)は底面図である。
- 【図3】 図3は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その2)を示す図である。図3(a)は上面図、図3(b)は図3(a)におけるE-E線断面図、図3(c)は底面図である。
- 【図4】 図4は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられる銅板51(その3)を示す図である。図4(a)は上面図、図4(b)は図4(a)におけるF-F線断面図、図4(c)は底面図である。
- 【図5】 図5は本発明の実施の形態1の半導体装置3に用いられるリードフレーム60のソースリード63部分を示す部分図である。図5(a)は平面図、図5(b)は側面図である。
- 【図6】 図6は本発明の実施の形態2の半導体装置4を示す図であり、図6(a)は平面図、図6(b)は図6(a)におけるG-G線断面図である。
- 【図7】 図7は本発明の実施の形態2の半導体装置4に用いられる銅板56を示す図である。図7(a)は上面図、図7(b)は図7(a)におけるHーH線断面図、図7(c)は底面図である。
- 【図8】 図8は、ワイヤボンディング法による従来の一例の半導体装置1を示す図である。図8(a)は平面図、図8(b)は図8(a)におけるA-A線断面図である。
 - 【図9】 図9は、金属板接続による半導体装置2を示す図である。図9(

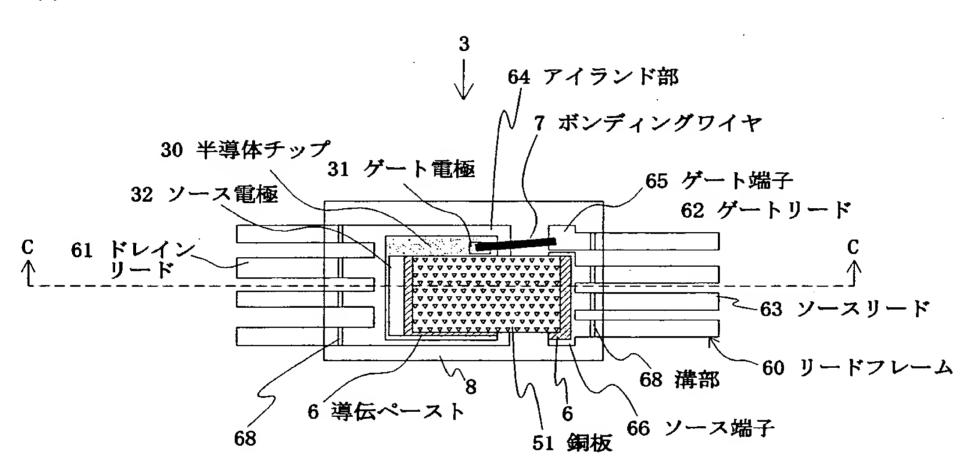
a) は平面図、図9(b) は図9(a) におけるB-B線断面図である。

【書類名】

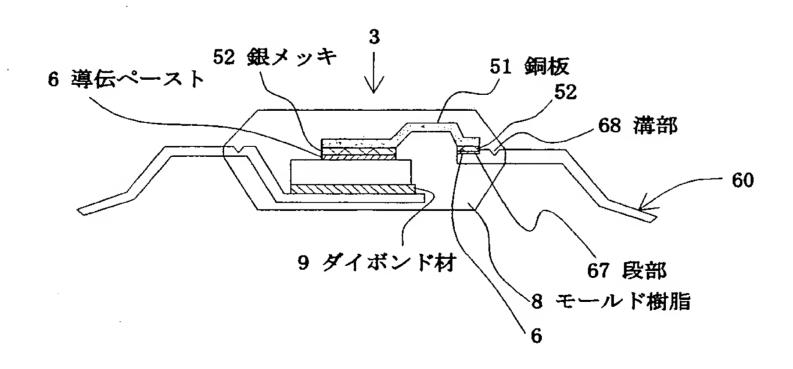
図面

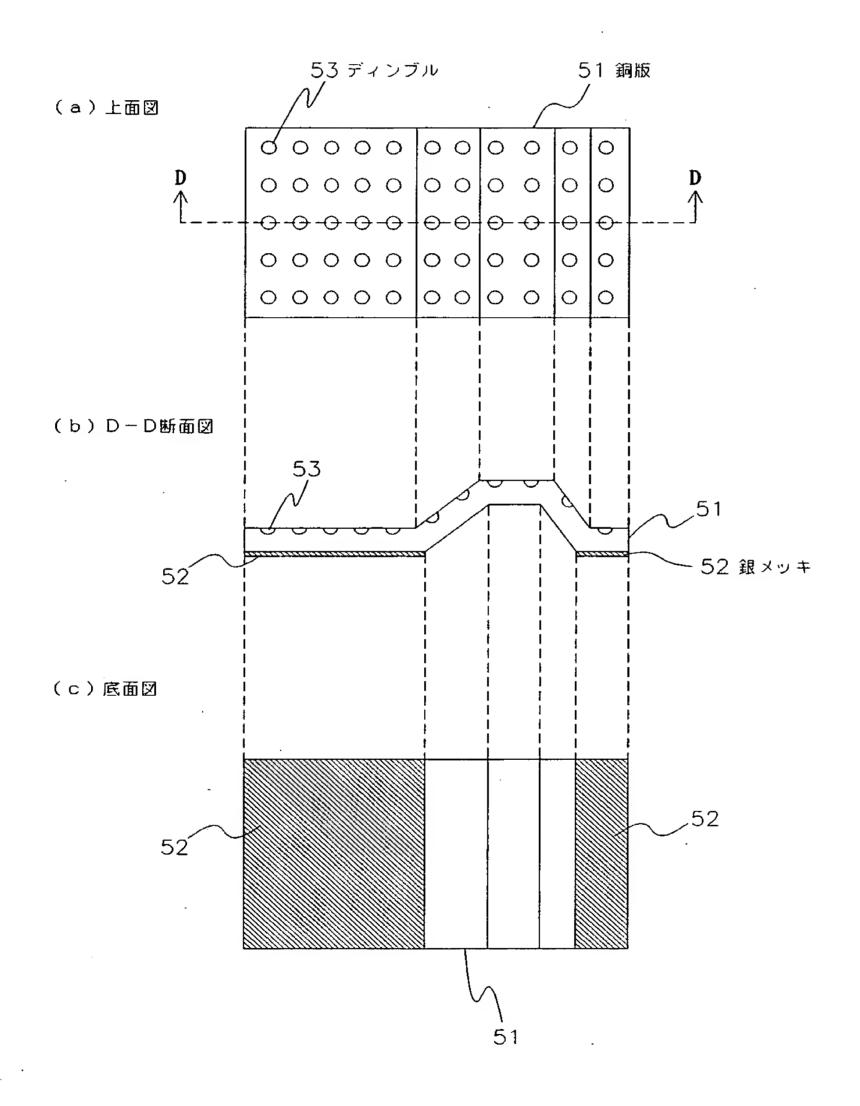
【図1】

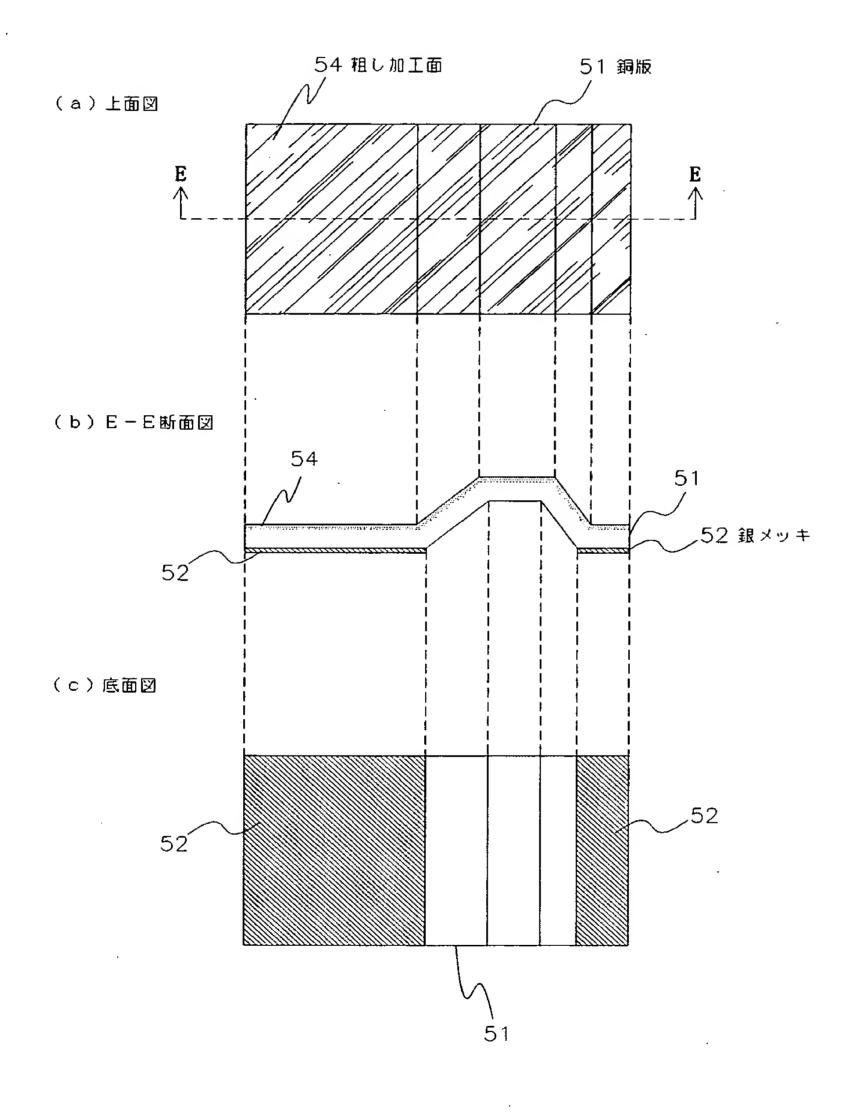
(a)

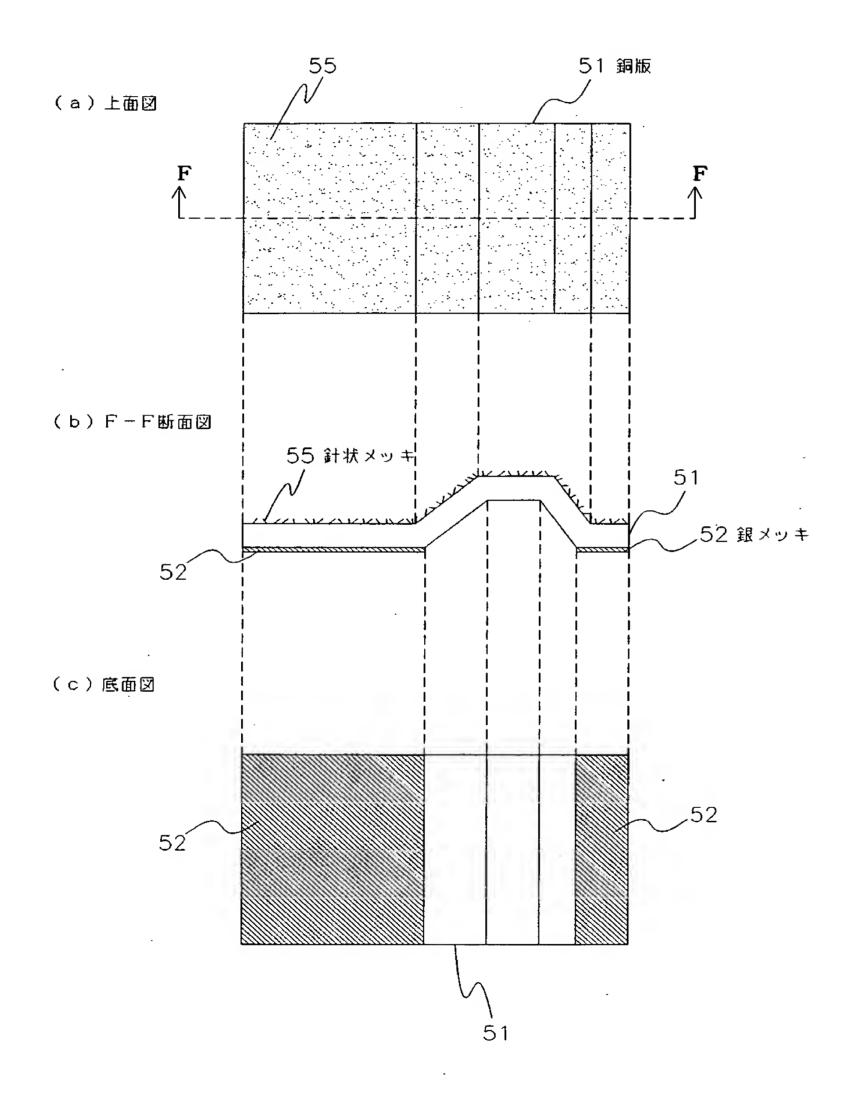


(b) C - C 断面図

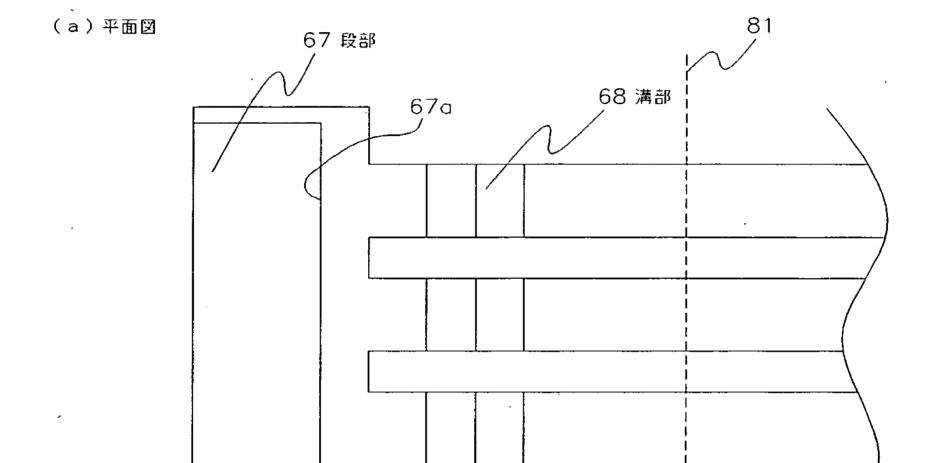


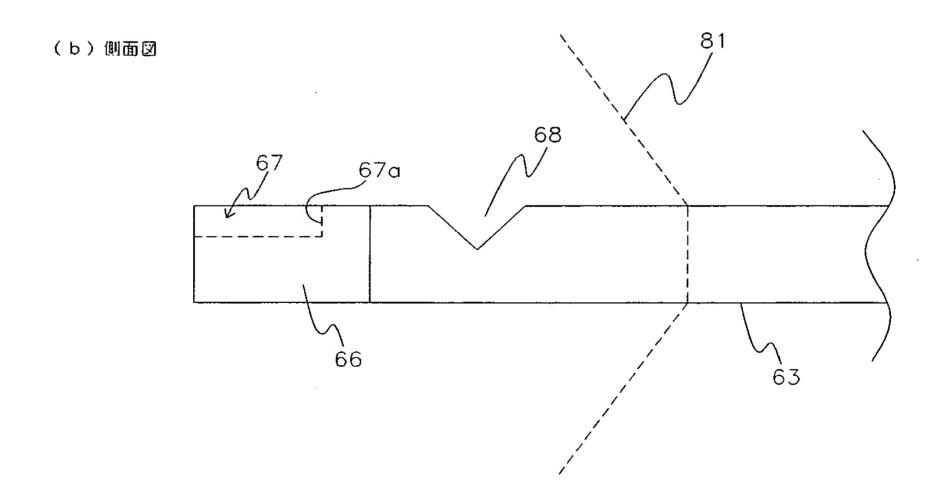






【図5】



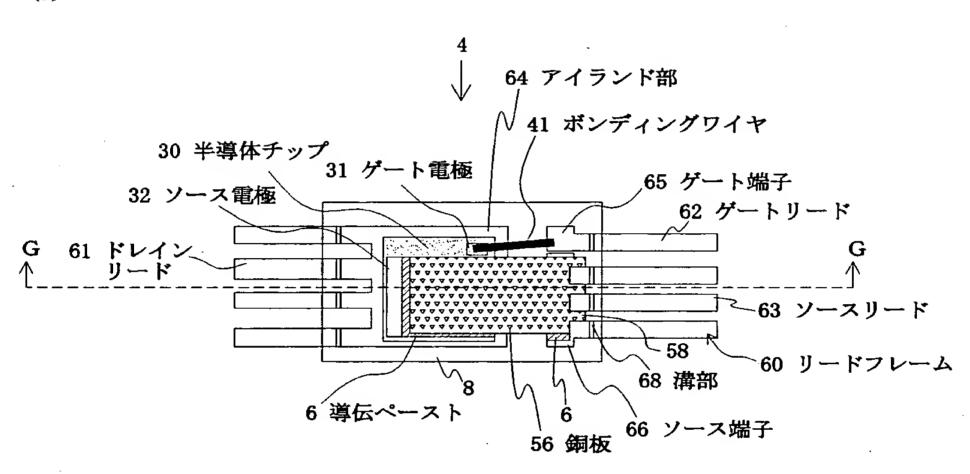


66 ソース端子

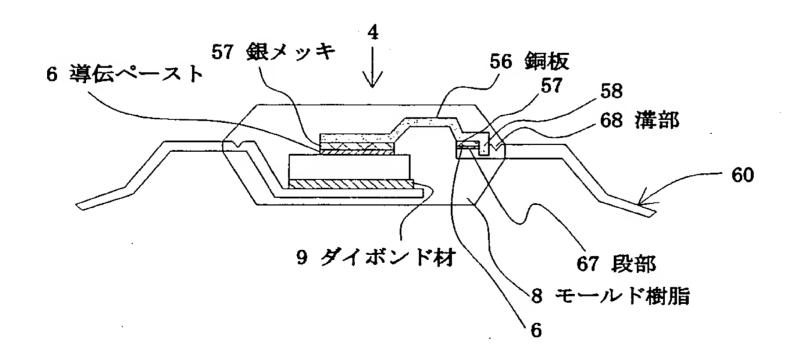
63 ソースリード

【図6】

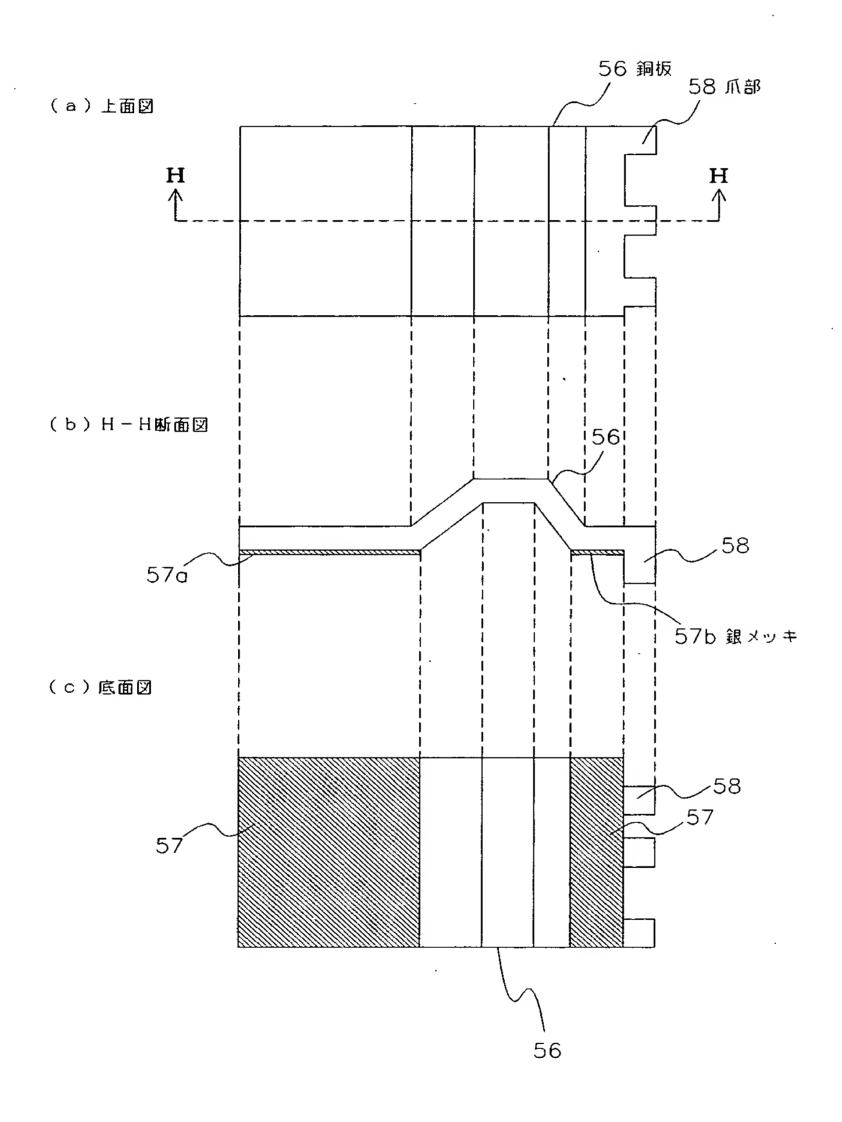
(a)

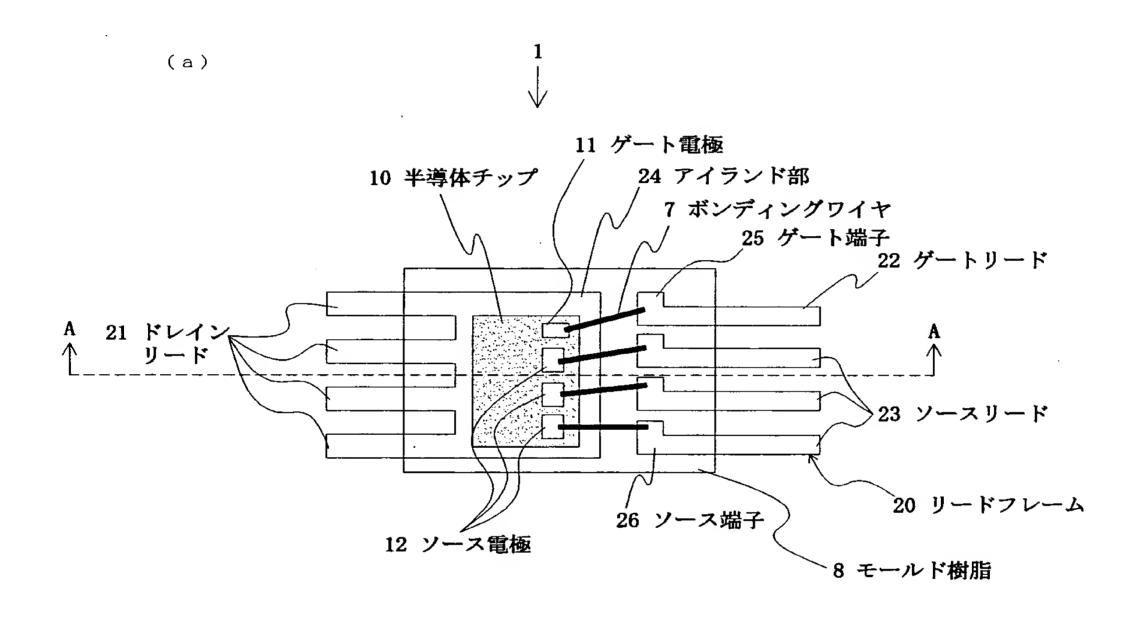


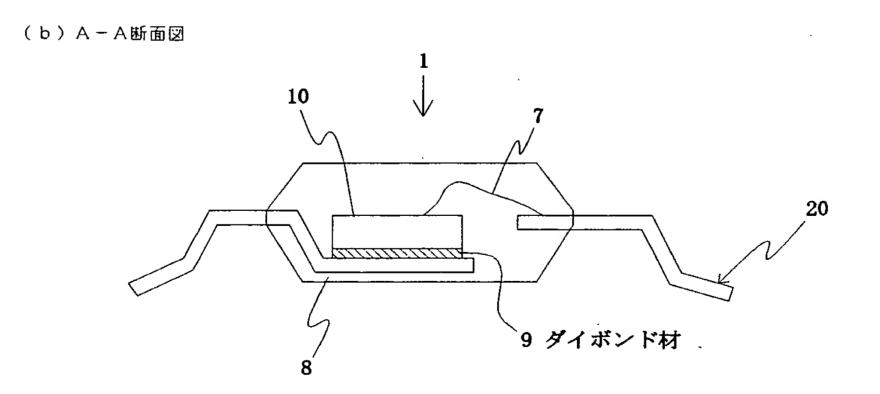
(b) G-G断面図



【図7】

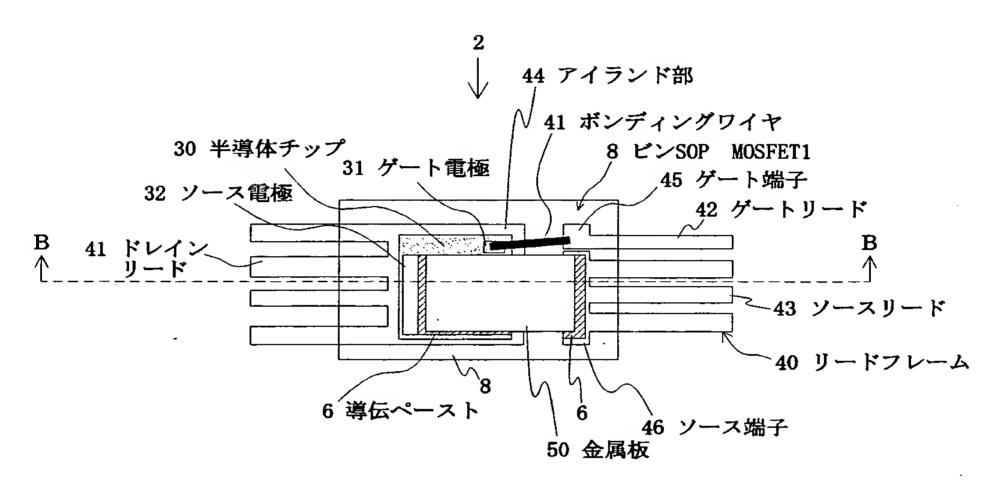




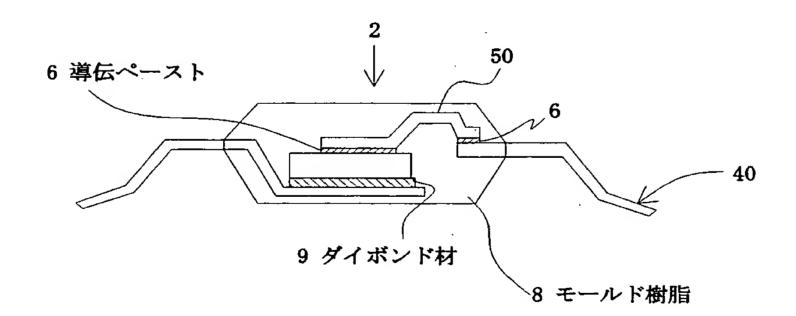


【図9】

(a)



(b) C-C断面図





【要約】

【課題】チップ電極とリードフレームを接続する金属板と封止樹脂との密着性を向上することにより、また、リード端子と金属板との接合に用いられる導電性接合材が、金属板とリード端子との接合範囲以外に流出することを防止することにより、半導体装置の信頼性の向上を図る。さらに、金属板を精度良く搭載することを課題とする。

【解決手段】半導体チップ30のソース電極32とリードフレーム60のソース端子66とを銅板51によって電気的に接続し、樹脂封止されてなる半導体装置(プラスチックパッケージ)3において、銅板の表面を粗し加工してモールド樹脂8との密着性を向上した。また、ソース端子66に段部67を設けて導電ペースト6の流出を防止した。爪部58をリードフレーム60に嵌合させる構造とした(図6)。

【選択図面】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社